

ポジ型フォトレジストの構造解析

熱分解GC/MS法により感光剤の構造解析が可能

測定法 : GC/MS
 製品分野 : 電子部品
 分析目的 : 組成評価・同定

概要

ポジ型フォトレジストは、半導体デバイス製造時のフォトリソグラフィ材料として広く用いられています。レジストに使用される素材は露光光源によって大きく異なりますが、g線、i線用のレジストでは一般にベース樹脂としてクレゾールノボラック樹脂、感光剤としてナフトキノンジアジド化合物が用いられています。本事例では熱分解GC/MS法によってナフトキノンジアジド化合物を分解し、母核の構造を推定した事例を紹介します。

データ

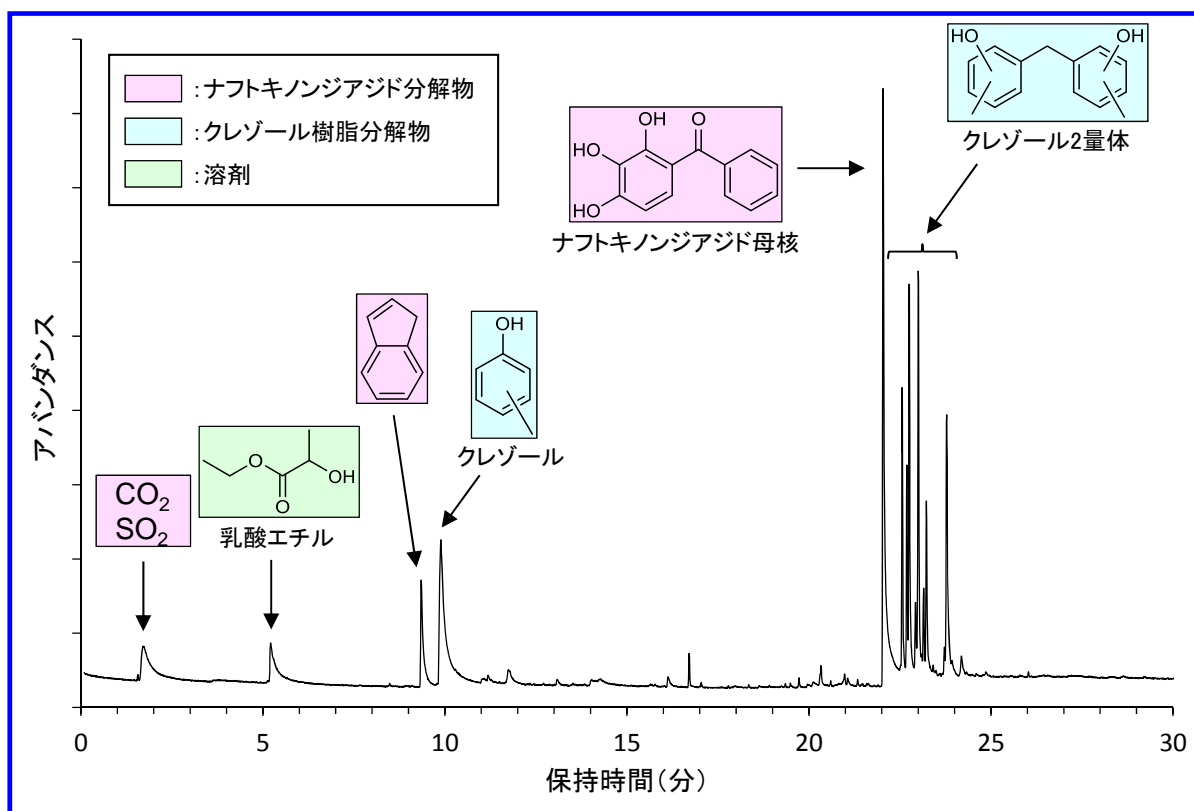
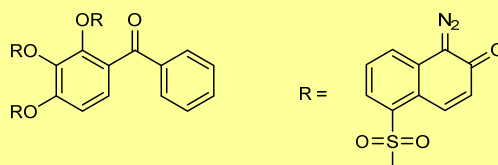


図1 熱分解GC/MSクロマトグラム

ナフトキノンジアジド化合物の推定構造



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
 URL : <http://www.mst.or.jp/>